化合物太陽電池

高本 達也

ソーラーシステム開発本部 次世代要素技術開発センター

Ⅲ-V族化合物半導体の組成比を制御してバンドギャップの異なる複数の太陽電池層を重ねた多接合太陽電池では、50%(集光時)を超える変換効率が期待されています。InGaPトップセル、InGaAsミドルセルおよびGeボトムセルの3つの太陽電池を重ねた3接合型太陽電池は、既に宇宙用で実用化され、地上での集光システム用に開発が進められています。今回、3接合型を更に改良し、格子不整合材料であるInGaAsボトムセルを用いた構造で35.8%(非集光)の世界最高効率を達成しましたので、その技術について解説します。

多接合型太陽電池

1つの半導体材料から成る太陽電 池では、幅広いエネルギー分布を有 する太陽光を高効率でエネルギー変 換することに限界があり、これを克 服する方法として、バンドギャップ エネルギーの異なる材料からなる複 数の太陽電池を積み重ねた、いわゆ る、多接合太陽電池を構成する方法 があります。多接合太陽電池を構成 する材料として、組成比の制御によ り様々な組合せのバンドギャップエ ネルギーの半導体を任意に形成で き、さらに、高品質の単結晶薄膜が 作製できる III-V族化合物半導体材 料が有効です。

図1は、多接合太陽電池の変 換効率と重ね合わせる太陽電池の 数(接合数)との関係を示しま す。非集光および1000倍集光時 の変換効率の理論値はそれぞれ、 Eg=1.4eVの単接合セルで31%お よび37%, Eg=1.56eV/0.94eV の2接合型で42%および50%, Eg=1.78eV/1.18eV/0.94eVの3 接合型で47%および56%であり、36 接合にて61%および72%と計算され ています。一方、実際の太陽電池の 非集光での最高効率として、GaAs単 接合で25.7%, InGaP/GaAs 2 接合で 30.3%, InGaP/GaAs/InGaAs3 接合



で35.8%が実現されています。また、 集光時の最高効率として、InGaP/ (In) GaAs/Ge3 接合型で41.6% (350 倍集光時)が達成されています。最 高効率は、全て化合物太陽電池で達 成されていますが,理論値と差は大 きく、少数キャリアの表面及び結晶 中での再結合損失が0 でないことが 主な原因です。化合物の特長を活か し、表面はヘテロ構造をとっていま すが. 表面再結合速度は数100cm/s と,酸化膜を形成したシリコン表面 の最良の状態と比べ2桁大きな値と なっています。また、バンド間再結 合(発光再結合)が結晶中の再結合 損失の主要因となっており、この損

失を低減するためには,発光再吸収 (フォトンリサイクリング)等の革 新的技術の開発が望まれます。

2 格子整合型3接合太陽電池

現在,既に人工衛星の電源とし て実用化されている II-V 族多接合 型太陽電池は,図2に示すような Ge 基板上にエピタキシャル成長し た単結晶薄膜からなる In_{0.49} Ga_{0.51} P/ In_{0.01} Ga_{0.99} As/Ge 構造の3接合型太 陽電池です。InGaP (1.88 eV) トップ セルおよび InGaAs (1.40 eV) ミドル セルの格子間隔がGe (0.67 eV) ボト ムセル(基板)の格子間隔とほぼ一 致した格子整合型の太陽電池です。

n.GabsContact	oating
n-AlInP window	InGa
n-InGaP emitter	top (a)
p-InGaP base	(1.800.
p-AlInP BSF	ndjunction
p-AlGaAs/n-InGaP	tunute
n-InGaP window	InGaAs
n-InGaAs emitter	middleter
p-InGaAs base	(1.40ev)
p-InGaP BSF	andjunctur
p-GaAs/n-GaAs	tulu
n-InGaAs buffer	buffer-lay
InGaP 1st layer	Ge
n-Ge	bottom cell
p-Ge	0.050 de
	1.0

図2 In_{0.49}Ga_{0.51}P/In_{0.01}Ga_{0.99}As/Ge 3接合型太陽電池の構造

変換効率は宇宙光(AM0スペクトル) に対して約29%で,宇宙用シリコン 太陽電池の約17%を大きく上回って います。高効率であることからパネ ルの枚数を削減でき,姿勢制御や打 上に要する総コストが低減できるた め,全世界の宇宙用太陽電池の中で, 約97%以上はこのような化合物3接 合太陽電池が使用されています。

また、同様の化合物3接合にて集 光型太陽電池の開発が進められてい ます。レンズやミラーによって太陽 光を500倍以上の光強度に集光し、 小面積の太陽電池に照射して発電す るシステムにより、太陽電池に要す るコストを大幅に削減することがで きます。また、光照射強度の増加に よる開放電圧の増加により、太陽電 池の変換効率が向上することも1つ の利点になっています。非集光時

表1 宇宙用太陽電池と集光用太陽電池の概要比較



30%程度の効率が1000倍集光時に 40%まで向上します。

表1は、宇宙用太陽電池と集光用 太陽電池の構造、特性の比較等を示 します。宇宙用太陽電池は紫外光を 多く含む宇宙光に対して高効率にな るように、また、宇宙空間で照射さ れる放射線に対して劣化が小さくな るように、トップセルが薄くなって います。集光用太陽電池では、大電 流発生によるエネルギー損失(I2R) を抑制するために、直列抵抗の低減 が最も重要であり、電極設計最適化 やトンネル接合ピーク電流の向上が 図られています。

InGaP/(In)GaAs/Ge3接合型宇 宙用太陽電池をソーラーカー用に東 海大学に提供しました(図3)。フ



(グローバルグリーンチャレンジ2010で優勝)

イルムでラミネートしたモジュール で、変換効率30%超(AM1.5スペ クトル地上光下)を実現しました。 豪州を縦断するグローバルグリー ンチャレンジ(2009年10月末開催) にて優勝いたしました。車体の重 量は約160kg、太陽電池のみの走行 で95km/h、バッテリー併用で最高 150km/hが可能とされています。

3 格子不整合型3接合太陽 電池

上述の格子整合系3接合構造では、 ボトムセルのバンドギャップが小さ 過ぎることから、ボトムセルで発生 する光電流がトップセルおよびミド ルセルで発生する光電流より1.8倍 程度も大きく、3接合セルの短絡電流 値はトップセルおよびミドルセルの 発生電流で制限されており、ボトム セルで発生した余分な電流は電力と して取り出すことができません。つ まり、格子整合型3接合構造(図4 中の①)では、電流バランスの観点 からバンドギャップの組合せは最適 ではありません。トップ, ミドル及 びボトムの3つのセルがトンネル接 合によって直列に接続されたモノリ シック構造では、3つのセルで発生す る電流が等しくなるように電流バラ

ンスを図ることが高効率化のために 重要です。3接合構造において電流バ ランスを達成して、より一層の高効 率化を図るためには、トップセル及 びミドルセルのEgを低下させた構造 (図4中の②),もしくは、ボトムセ ルのEgを増加させた構造(図4中 重の③)が有望であると考えられま す。図4に、代表的な3接合太陽電 池のバンドギャップ (Eg) の組み合 わせと格子定数の変化を示します。 また. トップ. ミドル. およびボト ムセルの電流および電圧についても 示しています。②の構造では、短絡 電流の向上による変換効率の向上が 期待されますが. InGaP トップセルと InGaAsミドルセルがGeボトムセル に対して1.2%の格子不整合を有しま す。③の構造では、開放電圧の向上 による効率向上が期待されますが. InGaAsボトムセルがトップセルお よびミドルセルに対して2%程度の 格子不整合となります。いずれの場 合も,現在主流の格子整合型(①) 構造セルと比較して. バンドギャッ プ組合せの最適化により3-5%(絶 対値)の変換効率の向上が期待され ますが,格子不整合セルの結晶品質 向上が重要な課題となります。

(1) 順積み格子不整合型

図4の②の構造の順積み格子不整



図4 代表的な3接合太陽電池のバンドギャップ(Eg)の組み合わせと格子定数の変化。 (下図は、トップ、ミドル、およびボトムセルの電流および電圧を示す)

合型3接合セルでは、Ge(ボトムセル) 基板上に格子不整合のIn_{0.17}Ga_{0.83}As ミドルセルおよびIn_{0.65}Ga_{0.35}Pトッ プセルがエピタキシャル成長され ます。トップおよびミドルセルで は、格子不整合によるミスフィット 転位の発生は避けられません。ミス フィット転位はダイオードの逆方向 飽和電流を増加させ、開放電圧を僅 かに(<50mV程度)低下させます が、量子効率への影響つまり短絡電 流の低下は殆ど無いことが確認され ています。よって、格子不整合系の 太陽電池では、ミスフィット転位以 外の転位の伝播を防止することが重 要であり、基板(兼ボトムセル)と ミドルセルの間の格子定数を増加さ せるためのバッファー層の中で貫通 転位を閉じ込めることが重要になり ます。ドイツのFraunhofer-ISEで は、順積み格子不整合型3接合セル で41.1%(454 sun)の変換効率が達 成しています。

(2) 逆積み格子不整合型

図4の③の構造の逆積み格子不整 合型3接合セルを実現するために, 図5に示すような逆方向エピタキ



図5 逆積み格子不整合型3接合太陽電池の作製プロセス (バッファー層の改善による貫通転の伝播抑制、逆積み成長法、太陽電池層の転写) シャル成長プロセスとエピタキシャ ル成長層の転写プロセスを考案しま した。GaAs基板上に、通常とは逆 の順序で、格子不整合のボトムセル を最後に成長することで、格子整合 系のトップおよびミドルセルの高品 質結晶を維持することができます。 太陽光はトップセルから入射する必 要があるため、太陽電池層のボトム セル側に支持基板を貼り合せた後、 GaAs基板を分離(現状ではGaAs 基板を除去)します。

InGaAsボトムセルの最適なバン ドギャップは0.97~1.0eVであり, 基板との格子不整合度は約2%と大 きくなります。ボトムセルでのミ スフィット転位の発生は避けられ ませんが,格子定数を変化させる バッファ層の中で貫通転位を閉じ込 め,ボトムセルに転位が伝播しな いようにすることが課題となりま す。バッファ層からボトムセル層 (Eg=0.97eV)の断面のTEM観察 像(図5左)に示すように、バッ ファ層の改善前では、ボトムセルの 中に伝播した貫通転位が見られます が、改善後は、バッファ層の中で多 数の転位が効果的に閉じ込められ、 ボトムセルの中に貫通転位の存在は 認められません。バッファ層の改善 前後で、ボトムセルで発生する電圧 は0.52Vから0.57Vに向上しました。

図6に0.97eV-InGaAsのボトム セル用いて逆積み構造で作製した InGaP/GaAs/InGaAs3接合太陽電 池のIVカーブ(産業技術総合研究 所で測定)および分光感度特性を示 します。0.97eVのボトムセルの感 度波長は十分に広くトップセルおよ びミドルセルと同等の光電流が得ら





れています。また、ボトムセルの電 圧は0.57 eV 程度と高く、3 接合セル の開放電圧は3V を超える高い値と なり、変換効率35.8%(非集光の世 界最高記録)、が得られました。

4 逆積み格子不整合型3接 合太陽電池の将来性

今回,世界最高効率を達成した逆 積み格子不整合型3接合太陽電池は, 将来,以下に示すような特長が期待 されています。

(1) 集光による高効率化

従来構造において,非集光で 31%の効率が,1000倍集光時に40% を超える効率まで向上した実績か ら,非集光で35.8%のセルで,集 光時45%を超える効率実現の可能 性が見えてきました。

(2)新規用途対応

太陽電池層の転写プロセスにおい て、太陽電池層を放熱基板に転写す ることで高性能な集光セルが期待さ れ、フレキシブルフィルム等に転写 することで、軽量フレキシブルな太 陽電池 (宇宙用等)が期待されます。

(3) 省資源,低コスト化

太陽電池層をGaAs基板より分離 し、支持基板に転写した後、GaAs 基板を成長用に再利用することで、 基板のコストが削減できます。太陽 電池層は10µm以下の極薄層である ため、太陽電池の材料使用量を大幅 に削減することが可能となります。

(4) 4 接合化による高効率化

バンドギャップが0.65eV以下の 材料(格子不整合材料もしくは多結 晶材料等)から成る太陽電池を,逆 積み方法+転写プロセスによって, 3接合に追加することで4接合が可 能となり。非集光で40%,集光時 50%の高効率化が期待されます。